

ダイヤモンドパワーデバイスの開発に向けた活性サイト解析

加藤有香子1

1 産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター

1. 背景と研究目的

ボロンドープダイヤモンドは高耐圧、高速応答特性や熱 伝導性が高いワイドギャップ p 型半導体として、高出力電 力制御系でのパワーデバイス材料として期待されている[1]。 ドーパント制御は材料の電気特性を左右する重要な技術だ が、現状では経験的な濃度制御にとどまっており、同じ濃 度でも電気特性にばらつきが生じる。同じ濃度でも性能が 異なるという事は、ボロンの活性化率が試料によって異な る可能性が高い。アクセプタとして機能するボロンの原子 配列(活性サイト)を直接的に示すことができれば、活性化率 が高いダイヤモンドの合成条件を検討する際に重要な情報 となる。

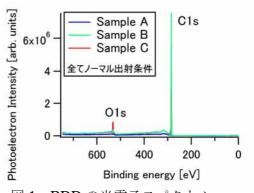


図1 BDD の光電子スペクトル

2. 実験内容

ボロンドープダイヤモンド(BDD)は、次の 3 つ用意した。ボロンをイオン注入した後アニール処理を施した BDD(Sample A)、CVD 法で作製した BDD(Sample B),高温高圧法で作製した BDD(Sample C)である。それぞれ、ボロン濃度は 10^{19} /cm³, 2×10^{20} /cm³, 5×10^{19} /cm³ である。これらの光電子分光実験を BL7Uで試みた。光電子の運動エネルギーが 600 eV 以上の時、光電子回折像には原子配列に対応する前方散乱ピークが現れる。この前方散乱ピークを用いて活性サイト解析を実施しているが、一方で軽元素かつ低濃度のボロンを検出する必要があったため、入射光エネルギーは BL7U が出せる入射光エネルギー領域の中で、エネルギーと輝度のバランスがとれる $500\sim800$ eV を用いた。

3. 結果および考察

いずれの試料でも、C1s を検出することはできた。図 1 に 3 つの試料の光電子スペクトルを示す。 Sample C は他の試料と比べて酸素のオージェ強度が高い。事前処理が十分でなかった可能性があるが、原因はまだ判明していない。B1s は、Sample B、

Sample C で検出できた。ただし、Sample B の B1s は解析に十分な S/B 比ではなかった。Sample C では、比較的十分な強度の B1s スペクトルが得られたが、図 2 に示すように、状態の異なる 2 種類の B の存在が示唆された。また、これらのピークは測定開始から 20 秒でピークが消滅した。このマシンタイムの後、洗浄をしてからもう一度別の装置で測定したところ、B1s のピークが現れた。このことから、B1s ピーク消滅は表面汚染によるものではないかと推察している。

4. 参考文献

1. Baliga, B. J., IEEE Electron Device L 10, 10, 455-457 (1989).

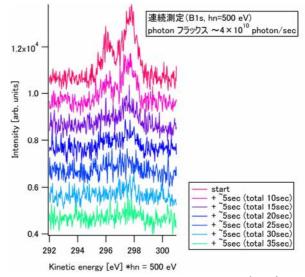


図2 Sample CのB1sスペクトル(時間変化)